

สมบัติโฟโตคะตะไลติกของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์
ที่เคลือบด้วยวิธี รีแอคทีฟ ดีซี สปีดเตอริง

พິงบุญ ปานศิลา

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มีนาคม 2553
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณา
วิทยานิพนธ์ของ พิงบุญ ปานศิลา ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของมหาวิทยาลัยบูรพาได้

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

..... อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุรสิงห์ ไชยคุณ)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธาน
(รองศาสตราจารย์ ดร. ณสรณ์ พลโกล)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุรสิงห์ ไชยคุณ)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ สำเภา จงจิตต์)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปราณี แก้วภิรมย์)

คณะวิทยาศาสตร์อนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา

..... คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษาวดี ตันติวรานุกษ์)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2553

การวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมวิทยานิพนธ์
จากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

และ

ทุนการศึกษาและวิจัยจาก

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

ประกาศคุณูปการ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงด้วยความกรุณาจากรองศาสตราจารย์ ดร. สุรสิงห์ ไชยคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้แนวคิดและคำแนะนำต่าง ๆ ในการทำวิทยานิพนธ์นี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ณสรรงค์ ผลโภค ที่ให้ความกรุณามาเป็นประธานกรรมการสอบ และขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์สำเภา จงจิตต์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปราณี แก้วภิมย์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ขาดเสียมิได้ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร์ วิทิตอนันต์ ที่กรุณาให้คำปรึกษาแนะนำตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความถี่ถ้วนและเอาใจใส่ รวมถึงให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้านเสมอมา

ผู้วิจัยขอขอบคุณแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนวิทยานิพนธ์ ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยบางส่วนจาก “ทุนอุดหนุนและส่งเสริมวิทยานิพนธ์” บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 และขอขอบคุณศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำหรับทุนการศึกษาและวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาแก่ข้าพเจ้า

ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกรัตน์ วงษ์แก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในด้านการทดสอบสมบัติโฟโตคะตะไลติก ผู้วิจัยรู้สึกทราบดีว่าเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิจัยพลาสมาสำหรับวิทยาศาสตร์พื้นผิวและห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือในการทำวิจัยด้วยดี ขอขอบคุณนายอดิสร บวรณวงษ์ เพื่อนที่คอยให้ความช่วยเหลือหลายประการในงานวิทยานิพนธ์นี้

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ บิดา มารดาและพี่น้อง ที่คอยให้ความช่วยเหลือเป็นกำลังใจ ตลอดเวลาเสมอมา รวมถึง ผู้หวังดีและเพื่อนสนิททุก ๆ คน ที่คอยให้กำลังใจยามท้อแท้หมดกำลังใจ และขอขอบคุณท่านอื่น ๆ ที่มีได้เอ่ยนามในที่นี้ ที่คอยให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือในหลายด้าน ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี

พึงบุญ ปานศิลา

48911001: สาขาวิชา: ฟิสิกส์; วท.ม. (ฟิสิกส์)

คำสำคัญ: फिल्मบาง/ไททานเนียมไดออกไซด์/รีแอคทีฟ ดีซี สปีดเตอริง/ โฟโตคะตะไลติก

พืงบุญ ปานศิลา: สมบัติโฟโตคะตะไลติกของฟิล์มบางไททานเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบด้วยวิธี รีแอคทีฟ ดีซี สปีดเตอริง (PHOTOCATALYTIC PROPERTY OF TiO₂ THIN FILMS DEPOSITED BY REACTIVE DC SPUTTERING) คณะกรรมการควบคุมควบคุมวิทยานิพนธ์: สุรสิงห์ ไชยคุณ, Ph.D. 141 หน้า. ปี พ.ศ. 2553.

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเคลือบฟิล์มบางไททานเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธีรีแอคทีฟ ดีซี สปีดเตอริง และศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มที่เคลือบได้ รวมถึงผลของอัตราไหลแก๊สในกระบวนการเคลือบและผลของความหนาฟิล์มที่มีต่อสมบัติโฟโตคะตะไลติกของฟิล์มอีกด้วย วัสดุรองรับที่ใช้ในการเคลือบฟิล์มครั้งนี้ คือ แผ่นกระจกสไลด์และแผ่นซิลิกอน โดยมีเงื่อนไขการเคลือบฟิล์มคือ แปรค่าตำแหน่งวางวัสดุรองรับในแนวรัศมีและแปรค่าอัตราไหลแก๊สในกระบวนการเคลือบ สำหรับฟิล์มที่เคลือบได้นำมาศึกษาโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิค XRD และศึกษาลักษณะพื้นผิว ความหนาของฟิล์มด้วยเทคนิค AFM สำหรับสมบัติโฟโตคะตะไลติกของฟิล์มจะพิจารณาจากความสามารถในการย่อยสลายสารเมทิลีนบลูของฟิล์มหลังสัมผัสแสงยูวี ผลการศึกษาพบว่าฟิล์มไททานเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบได้มีโครงสร้างผลึกแบบอนาเทสและแบบผสมของอนาเทส/รูไทล์ ลักษณะพื้นผิวและความหนาของฟิล์มที่เคลือบได้จะเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขในการเคลือบ ฟิล์มบางไททานเนียมไดออกไซด์ทั้งหมดที่เคลือบได้สามารถแสดงสมบัติโฟโตคะตะไลติกได้ในทุกเงื่อนไขของการเคลือบ ทั้งนี้เมื่อพิจารณากรณีการเคลือบฟิล์มด้วยอัตราไหลแก๊สอาร์กอนต่อออกซิเจนเท่ากับ 1:4 sccm พบว่าฟิล์มบางไททานเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบได้มีความสามารถในการเกิดกระบวนการโฟโตคะตะไลติกได้ดีที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่าฟิล์มบางไททานเนียมไดออกไซด์ที่มีความหนาเพิ่มขึ้นจะมีความสามารถในการเกิดกระบวนการโฟโตคะตะไลติกได้ดียิ่งขึ้น

48911001: MAJOR: PHYSICS; M.Sc. (PHYSICS)

KEYWORDS: THIN FILM/ TITANIUM DIOXIDE/ REACTIVE DC SPUTTERING/
PHOTOCATALYTIC PROPERTY

PUNGBOON PANSILA: PHOTOCATALYTIC PROPERTY OF TiO₂ THIN FILMS
DEPOSITED BY REACTIVE DC SPUTTERING. ADVISORY COMMITTEE: SURASING
CHAIYAKUN, Ph.D. 141 P. 2010

The main objectives of this research were to study the deposition of titanium dioxide thin films by reactive DC sputtering. In addition, characterizations of the films, the effects of mixed gas flow rate in the coating process and thickness on the photocatalytic properties of the films were also revealed. In this study, the films were deposited on glass slide and silicon wafer under various radial positions of substrate and gas flow rate. The crystal structures of the films were characterized by XRD, while the surface morphologies and thicknesses were evaluated by AFM. The photocatalytic activity was evaluated by the measurement of the decomposition of methylene blue after UV irradiation. From the results, it was found that the films were composed of crystalline anatase structure and the mixture of anatase/rutile structure. The surface morphology and thickness of the films were changed the deposited conditions. The films show the photocatalytic properties obtained from all process conditions. In addition, it was found that the titanium dioxide thin film deposited using the flow rate ratio of argon:oxygen (1:4 sccm) exhibited the best photocatalytic property. Moreover, it was found that the photocatalytic activity increases with increasing film thickness.

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	จ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ฉ
สารบัญ	ช
สารบัญตาราง	ญ
สารบัญภาพ	ฉ
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	4
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย	4
ขอบเขตของการวิจัย.....	4
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	5
กระบวนการเคลือบฟิล์มบาง	5
การก่อเกิดฟิล์มบาง	6
โครงสร้างของฟิล์มบาง.....	8
การเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธี สปีดเทอริง	10
กระบวนการ โกลด์วิเศษาร์จ	17
ระบบเคลือบแบบ ดีซี สปีดเทอริง	22
ระบบเคลือบแบบ ดีซี แมกนีตรอน สปีดเทอริง	24
ระบบเคลือบแบบ อันบาลานซ์ แมกนีตรอน สปีดเทอริง	28
การเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธี รีแอกตีฟ สปีดเทอริง	31
ไททานเนียมไดออกไซด์.....	33
ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส.....	37
การหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางไททานเนียมไดออกไซด์.....	45
การทดสอบสมบัติโฟโตคะตะไลติกของฟิล์มบางไททานเนียมไดออกไซด์.....	53

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2-1 พลังงานขีดเริ่มของเป่าสารเคลือบชนิดต่าง ๆ	14
2-2 ข้อมูลการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของผลึกไททานเนียมไดออกไซด์เฟสอานาเทส	35
2-3 ข้อมูลการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของผลึกไททานเนียมไดออกไซด์เฟสรูไทล์	36
3-1 เงื่อนไขการเคลือบฟิล์มบางไททานเนียมไดออกไซด์แปรค่าตำแหน่ง d_x	92
3-2 เงื่อนไขการเคลือบฟิล์มบางไททานเนียมไดออกไซด์ที่อัตราไหล แก๊สอาร์กอนต่อออกซิเจนต่าง ๆ กัน.....	93
3-3 เงื่อนไขการเคลือบฟิล์มบางไททานเนียมไดออกไซด์บนกระจกสไลด์ ที่อัตราไหลแก๊สอาร์กอนต่อออกซิเจนต่าง ๆ กัน	95
3-4 เงื่อนไขการเคลือบฟิล์มบางไททานเนียมไดออกไซด์บนกระจกสไลด์ ที่เวลาการเคลือบฟิล์มต่าง ๆ กัน.....	98
4-1 ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มบางไททานเนียมไดออกไซด์ เคลือบโดยแปรค่า d_x	102
4-2 ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มบางไททานเนียมไดออกไซด์ เคลือบโดยแปรค่าอัตราไหลแก๊สอาร์กอนต่อออกซิเจน.....	105
4-3 ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มบางไททานเนียมไดออกไซด์ เคลือบบนกระจกโดยแปรค่าอัตราไหลแก๊สอาร์กอนต่อออกซิเจน	109
4-4 ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มบางไททานเนียมไดออกไซด์ เมื่อใช้เวลาการเคลือบฟิล์มต่าง ๆ กัน	114
ก-1 ค่าแอมพลิจูดของสารเมทิลีนบลูบนฟิล์มบางไททานเนียมไดออกไซด์ที่ เคลือบด้วยอัตราไหลแก๊สอาร์กอนต่อแก๊สออกซิเจนต่างกัน	138
ก-2 ค่าแอมพลิจูดของสารเมทิลีนบลูบนฟิล์มที่มีความหนาต่างกัน	138
ก-3 ผลต่างค่าการส่งผ่านแสงของฟิล์มที่เคลือบด้วยอัตราไหลแก๊สอาร์กอน ต่อแก๊สออกซิเจนต่างกัน หลังจากฉายยูวีเป็นเวลา 6 ชั่วโมง	139
ก-4 ผลต่างค่าการส่งผ่านแสงของฟิล์มที่มีความหนาต่างกัน หลังจากฉายยูวีเป็นเวลา 6 ชั่วโมง.....	140

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2-1 การก่อเกิดฟิล์มบาง	7
2-2 โครงสร้างของการเกิดฟิล์มในรูปแบบต่าง ๆ	9
2-3 อันตรกิริยาระหว่างไอออนกับพื้นผิววัสดุ	11
2-4 ลักษณะของเครื่องเคลือบสุญญากาศด้วยวิธีสปัตเตอร์ริง	12
2-5 ยี่ลด์ของทองแดงที่ถูกชนด้วยไอออนจากแก๊สอาร์กอนที่พลังงานต่าง ๆ	14
2-6 การเปลี่ยนแปลงค่ายี่ลด์ของเป้าทองแดง (Cu) , เงิน (Ag) และแทนทาลัม (Ta) เมื่อใช้ไอออนพลังงาน 45 keV จากธาตุที่มีเลขอะตอมค่าต่าง ๆ	16
2-7 การเปลี่ยนแปลงของยี่ลด์เมื่อใช้ไอออนของปรอทพลังงาน 200 eV ชนเป้านิกเกิล (Ni), โมลิบดีนัม (Mo), ทังสเตน (W) และทองคำขาว (Pt) ที่มุมการตกกระทบ ค่าต่าง ๆ (วัดเทียบกับแนวชนตั้งฉากบนเป้า)	16
2-8 ความสัมพันธ์ของความหนาแน่นกระแสและแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วอิเล็กโตรด ของกระบวนการเกิด ดีซี โกลว์ดีสชาร์จ ในหลอดสุญญากาศบรรจุแก๊สไนออน	18
2-9 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าทะลุและผลคูณระหว่างความดัน (P) และระยะระหว่างอิเล็กโตรด (d)	19
2-10 โกลว์ดีสชาร์จของหลอดไนออนยาว 50 cm. ที่ความดัน 1.33 mbar	20
2-11 ระบบสปัตเตอร์ริงแบบ ดีซี สปัตเตอร์ริง	22
2-12 ผลของความดันในระบบที่มีผลต่ออัตราเคลือบ ค่ายี่ลด์และกระแสไฟฟ้าใน ระบบสปัตเตอร์ริงของนิกเกิลที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 3,000 V ระหว่างขั้วอิเล็กโตรด ที่วางห่างกัน 4.5 cm	23
2-13 การเคลื่อนที่ของอนุภาคอิเล็กตรอนในสนามแม่เหล็ก	24
2-14 การเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามต่างๆ โดยที่ a , b , c เป็นการเคลื่อนที่ของ อนุภาคประจุในสนามแม่เหล็กอย่างเดียว ส่วน d และ e เป็นการเคลื่อนที่ของ อนุภาคประจุในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าร่วมกันในลักษณะต่าง ๆ	26
2-15 การจัดสนามแม่เหล็กและแนวการกักตร้อนของเป้าสารเคลือบในระบบพลาสมา แมกนีตรอน สปัตเตอร์ริง	27
2-16 ลักษณะเส้นแรงแม่เหล็กของระบบอเนบาลานซ์ แมกนีตรอน สปัตเตอร์ริง	29
2-17 ลักษณะพลาสมาของระบบสปัตเตอร์ริง	31

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
2-18 การเกิดปฏิกิริยารวมตัวกันเป็นสารประกอบระหว่างแก๊สไอปฏิกิริยากับอะตอม เข้าสารเคลือบในบริเวณต่างๆ	32
2-19 เฟสของไททานเนียมไดออกไซด์.....	34
2-20 ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสที่สร้างขึ้นด้วยไททานเนียมไดออกไซด์ และปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสต์ในธรรมชาติ	38
2-21 เปรียบเทียบปฏิกิริยาเมื่อไม่ใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาและใส่ตัวเร่งปฏิกิริยา	38
2-22 สเปกตรัมของคลื่นแสงย่านรังสียูวี.....	39
2-23 กลไกการเกิดโฟโตคะตะไลซิสต์ของไททานเนียมไดออกไซด์.....	41
2-24 โครงสร้างของอิเล็กตรอนในไททานเนียมไดออกไซด์.....	42
2-25 แสดงกลไกปฏิกิริยาออกซิเดชัน	43
2-26 แสดงกลไกปฏิกิริยารีดักชัน	43
2-27 แบบจำลองการเรียงตัวของอะตอม	46
2-28 ความเข้มของฟิล์มที่แสดงถึงระนาบผลึกของวัสดุในตำแหน่งที่มีการสะท้อนรังสี	48
2-29 องค์ประกอบหลักของเครื่องมือ Scanning Probe Microscope.....	49
2-30 ลักษณะของแรงกระทำระหว่างอะตอมที่เกิดขึ้นในระยะห่างระหว่างวัตถุต่าง ๆ.....	49
2-31 เครื่อง AFM แบบ Multimode	50
2-32 ลักษณะการสั่นของคานที่มีเข็มติด	52
2-33 เปรี่เซ้นต์การส่งผ่านแสงของสารละลาย Methyl blue สำหรับฟิล์มบาง ไททานเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบที่ความดันรวมขณะเคลือบต่าง ๆ กัน	54
2-34 $\Delta\text{ABS}/\Delta\text{ABS}_{\text{max}}$ ในการสลายสารเมทิลีนบลู	55
2-35 การย่อยสลายสารเมทิลีนบลูในสารละลายบนฟิล์มที่เคลือบด้วยวิธี อาร์ เอฟ สปีดเทอริง.....	56
2-36 ชุดทดสอบสมบัติโฟโตคะตะไลติกโดยการวัดปริมาณความเข้มข้นของแก๊ส.....	57
2-37 ความเข้มข้นของ Acetaldehyde ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาในการฉาย UV ของฟิล์มบางที่เคลือบด้วยเทคนิค Sol-gel และ สปีดเทอริง	58
2-38 ความเข้มข้นของ Acetaldehyde ที่ลดลงตามเวลาการฉายแสงยูวี ของฟิล์มบาง เคลือบด้วยศักย์ไบแอสต่าง ๆ ที่ความดันรวมเท่ากับ 1.0 Pa	58

สารบัญภาพ (ต่อ)

2-39 การย่อยสลายทางแสงของสารละลาย Rhodamine B ณ อุณหภูมิอบอ่อนต่าง ๆ	60
2-40 ค่า $\ln(C_0/C)$ เมื่อฉายแสงยูวีที่อุณหภูมิของปฏิกิริยาเท่ากับ 298 K	60
2-41 ชุดทดสอบ Gas chromatograph	61
2-42 ปริมาณความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอน ไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเทียบกับเวลา ในฉายแสงยูวีจากการย่อยสลายด้วยแสงของแก๊ส Acetaldehyde จากกระบวนการโฟโตคะตะไลติก	61
3-1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย	73
3-2 เครื่อง X-Ray Diffractometer	75
3-3 เครื่อง Spectrophotometer for Color	76
3-4 เครื่อง Atomic Force Microscope	76
3-5 ส่วนประกอบหลักของระบบการเคลือบของเครื่องเคลือบ	77
3-6 เครื่องเคลือบในสุญญากาศที่ใช้ในงานวิจัย	78
3-7 โค้ดแกรมระบบเครื่องสุญญากาศ ของระบบเคลือบสปีดเตอริง	80
3-8 ขั้นตอนการล้างวัสดุรองรับ	81
3-9 ขั้นตอนการเตรียมสารละลายเมทิลีนบลู	84
3-10 ตัวอย่างสารละลายเมทิลีนบลูที่เตรียมได้	85
3-11 การแช่กระจกเคลือบฟิล์มไททานเนียมไดออกไซด์ในสารละลายเมทิลีนบลู	86
3-12 เมทิลีนบลูแห้งบนกระจกเคลือบฟิล์มไททานเนียมไดออกไซด์ ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ	86
3-13 ค่าแอมพลิจูดของสารเมทิลีนบลูความเข้มข้นต่าง ๆ บนฟิล์มชุดทดสอบ เมื่อฉายแสงยูวี 5 ชั่วโมง	87
3-14 การแช่ฟิล์มในสารละลายเมทิลีนบลูความเข้มข้น 1 mmol และกล่องสำหรับฉายแสงยูวี	89
3-15 การวางฟิล์มในกล่องฉายแสงยูวี	89
3-16 แผนผังการวางแผ่นซิลิกอนในภาชนะสุญญากาศ ที่ตำแหน่งแนวรัศมี (d_x) ต่าง ๆ	90
3-17 ขั้นตอนการเคลือบฟิล์มบางไททานเนียมไดออกไซด์โดยแปรค่า d_x	91
3-18 แผนผังการวางแผ่นซิลิกอนในภาชนะสุญญากาศที่ตำแหน่ง $d_x = 4$ cm	93

สารบัญภาพ (ต่อ)

3-19	ขั้นตอนการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยอัตราไหลแก๊สอาร์กอน	94
3-20	แผนผังการวางแผ่นกระจกสไลด์และแผ่นซิลิกอนในภาชนะสุญญากาศ	96
3-21	ขั้นตอนการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่มีความหนาต่างกัน	97
4-1	รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบได้ เมื่อแปรค่า d_x	100
4-2	ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบได้ เมื่อแปรค่า d_x	101
4-3	เปรียบเทียบความหนาของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์เคลือบที่ได้ เมื่อแปรค่า d_x ต่างกัน	103
4-4	เปรียบเทียบความหยาบผิวของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบได้ เมื่อแปรค่า d_x	103
4-5	รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ เคลือบที่ $d_x = 4$ cm เมื่อแปรค่าอัตราไหลแก๊สอาร์กอนต่อออกซิเจน	104
4-6	ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ เมื่อแปรค่าอัตราไหล แก๊สอาร์กอนต่อออกซิเจน	106
4-7	เปรียบเทียบความหนาของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์เคลือบที่ $d_x = 4$ cm เมื่อแปรค่าอัตราไหลแก๊สอาร์กอนต่อออกซิเจน	107
4-8	เปรียบเทียบความหยาบผิวของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์เคลือบที่ $d_x = 4$ cm เมื่อแปรค่าอัตราไหลแก๊สอาร์กอนต่อออกซิเจน	107
4-9	รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบได้ เมื่อแปรค่าอัตราไหลแก๊สอาร์กอนต่อออกซิเจน	109
4-10	ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มเคลือบเมื่อแปรค่าอัตราไหลแก๊สอาร์กอนต่อออกซิเจน	110
4-11	ค่าแอมพลิจูดของสารเมทิลีนบลูจากการทดสอบสมบัติ โฟโตคะตะไลติกของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบเมื่อแปรค่า อัตราไหลแก๊สอาร์กอนต่อออกซิเจน	112
4-12	การส่งผ่านแสงที่เพิ่มขึ้นหลังฉายแสงยูวี 6 ชั่วโมงจากการทดสอบสมบัติ โฟโตคะตะไลติกของฟิล์มที่เคลือบด้วยอัตราไหลแก๊สอาร์กอนต่อออกซิเจน ต่างกัน	112

สารบัญญภาพ (ต่อ)

4-13 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไททานเนียมไดออกไซด์ ที่เคลือบเวลาต่าง ๆ.....	113
4-14 ลักษณะพื้นผิวและความหนาของฟิล์มที่เคลือบด้วยเวลาเวลาการเคลือบต่างๆ กัน.....	115
4-15 ค่าแอมพลิจูดของสารเมทิลีนบลูจากการทดสอบสมบัติโฟโตคะตะไลติก ของฟิล์มที่มีความหนาต่างกัน	118
4-16 ค่าการส่งผ่านแสงของฟิล์มที่ข้อมเมทิลีนบลู เมื่อสัมผัสแสงยูวีเป็นเวลา 6 ชั่วโมง หลังการทดสอบสมบัติโฟโตคะตะไลติกของฟิล์มไททานเนียมไดออกไซด์ ที่มีความหนาต่างกัน	119